

研究会 開催案内

第2回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 26 年 7 月 23 日（水）13:30～18:00

会 場：機械振興会館

テーマ：シリコンフォトニクス

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成 26 年 7 月 30 日（水）13:30～17:10

会 場：住友電気工業（赤坂）

テーマ：ネットワークの限界を突破する次世代光デバイスの動向

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

第2回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 26 年 8 月 27 日（水）13:00～17:15

会 場：産総研・臨海副都心センター

テーマ：光応用プロセスの基礎と先端技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第2回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成 26 年 8 月 29 日（金）13:00～

会 場：機械振興会館

テーマ：情報通信技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第3回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 26 年 9 月 24 日（水）13:00～

会 場：産総研・臨海副都心センター

テーマ：エレクトロニクス産業を支える光プロセス最新動向（仮題）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 26 年 10 月 8 日 13:00～17:30

会 場：NTT 厚木

テーマ：光デバイス要素技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田 E-mail: pdevice@oitda.or.jp